

あとがき

高知県地域結集型共同研究事業は、長らく低迷する高知県産業界の起爆剤となって、硬直した本県の産業構造の転換を進め、県民の雇用の場を確保し、県民生活の向上を図るため、次世代情報デバイス関連の新産業創出を目指し、開始された。

平成9年度に高知県初の工科大として誕生した高知工科大学には、新材料の物性理論的研究、薄膜形成や次世代半導体開発技術等の分野において世界最高レベルの研究陣が参集しており、ここを研究拠点とし、カシオ計算機株式会社らの協力により「次世代情報デバイス用薄膜ナノ技術の開発」の研究に取り組むこととした。

しかしながら、上述のとおり技術シーズの集積はあるものの、事業開始当時、デバイス関連の研究に必要なインフラは整備されておらず、クリーンルームをはじめとする研究インフラ構築に一年以上を費やすこととなった。このため、事業開始直後からのスタートダッシュは図れず、やや立ち遅れた感があったのは事実である。その後、事業総括の強力なリーダーシップと高知県の多大なる支援、およびJSTの支援・指導により、平成16年3月のクリーンルーム竣工、研究装置や汎用プロセス機器の導入など研究設備の充実とともに、以降目覚ましい研究成果が創出されるようになった。

フェーズの終了を迎えた今、各研究テーマは実用化・事業化を目指し、次の段階に歩を進めているところである。主要テーマであったZnO-TFT、ZnO透明導電膜、FELに関係する産業分野は、この5年間だけでも想像を上回る急速な発展を遂げてきた。そういった中で、これらのテーマは、情報化社会のさらなる発展のためにその重要性・ニーズがより高まったと言えるのではないだろうか。フェーズでの成果の橋渡しとして獲得した研究事業2件はすでに動いている。それぞれのテーマにおいてフェーズでの更なる発展と早期の事業化が期待できる。

また、本事業のために高知に来た研究員も多い。彼らが今後も高知県に留まり研究開発を続けることは高知県にとって技術が地元根付く大きな財産となる。本事業に参画されたことに感謝するとともに、今後とも引き続き高知で活躍されることを期待する。

フェーズで最も期待したいことは、今以上の地場企業の参画である。本文中にも触れたが、先端技術をもって素材産業を狙う方向で進めば、地場企業が入り込める可能性は大きく高まるであろう。高知県産業振興センターとしても、企業間とのより密接な情報交換や、地域COEの研究拠点となるクリーンルームの活用などにより、地場企業の参画と地場企業の技術向上に寄与したい考えである。

最後に、独立行政法人科学技術振興機構には、事業推進に当たり多大なるご支援・ご指導をいただいた。また、この研究事業に関わった多くの研究者、関係機関の方々には多大なるご協力を賜った。皆様には引き続きのご支援をお願いするとともに、心より感謝申し上げたい。

平成20年1月

財団法人高知県産業振興センター